

# 分離技術会年会 2011 日 程

期間:平成23年6月3日(金)・4日(土)  
 場所:明治大学(生田キャンパス)第二校舎A館 4F

日時	講演会場A	講演会場B	ロビー	懇親会会場 食堂館入1721 (2階)
	基調講演 口頭発表 総会 特別講演 学生賞・奨励賞表彰	基調講演 口頭発表	ポスター発表 企業展示 技術相談	
6月3日(金)	午前 【膜分離・膜全般】 基調講演 S7-KN1 ~ S7-KN4 09:00 ~ 11:00  ポスター・プレビュー S7-P1 ~ S7-P15 11:00 ~ 12:00	【蒸留・シミュレーション】 基調講演 S2-KN 09:00 ~ 9:40  口頭発表 S2-1 ~ S2-5 09:40 ~ 12:00	ポスター発表 【吸着・吸収】S3-P1 ~ S3-P19 【晶析】S5-P1 ~ S5-P10 【流体固体分離】S6-P1 ~ S6-P6 09:40 ~ 10:50 奇数番号が発表 10:50 ~ 12:00 偶数番号が発表  企業展示・技術相談 09:40 ~ 12:00	
	午後 【吸着・吸収】 基調講演 S3-KN 13:00 ~ 13:40  口頭発表 S3-1 ~ S3-5 13:40 ~ 15:20	【相平衡・物性・分析技術】 基調講演 S1-KN 13:00 ~ 13:40  口頭発表 S1-1 ~ S1-7 13:40 ~ 16:00	ポスター発表 【抽出・超臨界抽出】S4-P1 ~ S4-P7 【膜分離・膜全般】S7-P1 ~ S7-P15 【プロセス化学と分離技術】S8-P1 ~ S8-P18 13:40 ~ 14:50 奇数番号が発表 14:50 ~ 16:00 偶数番号が発表  企業展示・技術相談 13:00 ~ 16:00	
		【特別講演】 PL-1 16:10 ~ 16:50		
		【総会】 17:00 ~ 17:30		
				懇親会 17:40 ~ 19:30
6月4日(土)	午前 【晶析】 基調講演 S5-KN 9:00 ~ 9:40  口頭発表 S5-1 ~ S5-6 09:40 ~ 11:40	【技術賞受賞講演】 AW-1 ~ AW-2 09:00 ~ 10:10  【流体固体分離】 口頭発表 S6-1 ~ S6-5 10:20 ~ 12:00	ポスター発表 【プロセス化学と分離技術】S8-P19 ~ S8-P20 【相平衡・物性・分析技術】S1-P1 ~ S1-P26 【蒸留・シミュレーション】S2-P1 ~ S2-P7 09:40 ~ 10:50 奇数番号が発表 10:50 ~ 12:00 偶数番号が発表 (S8-P19 ~ S8-P20は09:40 ~ )  企業展示・技術相談 9:40 ~ 12:00	
	午後 【特別講演】 PL-2 13:00 ~ 13:40			
	午後 【抽出・超臨界抽出】 基調講演 S4-KN 13:50 ~ 14:30  口頭発表 S4-1 ~ S4-6 14:30 ~ 16:30 学生賞・奨励賞表彰 16:50 ~ 17:30	【プロセス化学と分離技術】 基調講演 S8-KN1 ~ S8-KN3 13:55 ~ 15:25  口頭発表 S8-1 ~ S8-4 15:30 ~ 16:50		